

Спектральный эллипсометр Semilab SE-2000



Производитель:

Semilab

Цена:

Цена по запросу

Описание

Эллипсометр Semilab SE-2000 представляет собой уникальную модульную оптическую платформу, включающую спектроскопический эллипсометр с вращающимся компенсатором. Прибор оснащен автоматическим гониометром. Различные типы подложкодержателей, позволяют работать с образцами диаметром до 300 мм как в ручном, так и в автоматическом режиме с функцией картографирования (mapping). Гибкая конфигурация устройства позволяет добавлять в конструкцию электрофизические методы измерений.

Спектральный эллипсометр позволяет проводить бесконтактный, неразрушающий оптический анализ одно- и многослойных структур на кремнии, стекле, пленочном носителе, а также определять толщину тонкопленочных

образцов и их оптические свойства (коэффициент преломления, показатель поглощения). Модульный дизайн системы отвечает требованиям по измерению простых однослойных образцов и решению сложных задач, сочетающих в себе поляризацию, рефлектометрию, эллипсометрию с использованием матрицы Мюллера (исследование анизотропных материалов). Система оснащена уникальной возможностью независимого изменения угла наклона поляризатора и анализатора, имеет малый размер пятна (400 мкм). В зависимости от конфигурации, эллипсометр SE-2000 позволяет работать в спектральном диапазоне от дальнего УФ (190 нм) до среднего ИК (25 мкм) на одном гониометре (уникальный в своем классе прибор). Система оснащена специальным программным обеспечением для проведения измерений и анализа полученных данных (SAM/SEA). Имеется встроенная библиотека материалов (более 500) с известными показателями преломления и поглощения. Управление системой осуществляется с помощью стационарного ПК или ноутбука через внешнюю сеть, или же с помощью интерфейсной сенсорной панели.

Узнать теоретические основы эллипсометрии, а также особенности моделей и принцип работы эллипсометров Semilab, можно в нашей статье - [«Эллипсометрия в микроэлектронике»](#).

Режимы измерений

- спектральная эллипсометрия для измерения толщины тонких пленок и их оптических функций, включая сложные многослойные структуры;
- эллипсометрия анизотропных образцов;
- просвечивающая эллипсометрия прозрачных образцов;
- рефлектометрия в зависимости от длины волны и угла падения;
- матрица Мюллера (11 или 16 элементов), в сочетании с рефлектометрией для трехмерных анизотропных материалов;
- матрица Джонса для простых анизотропных материалов;
- измерение отражения и пропускания в зависимости от длины волны и угла падения;
- поляриметрия (измерение степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества);
- порометрия (патент Semilab): измерение распределения пор по размерам (от 0,5 до 60 нм) и пористости тонких пленок;
- режим измерения в реальном времени для контроля процесса осаждения или травления (опция in-situ).

Область применения

- Микроэлектроника, полупроводниковые материалы, МЭМС, LED;
- Материаловедение, анизотропные, пористые материалы, эпитаксиальные слои, ферроэлектрики, 3D-наноматериалы, сегнетоэлектрики, углеродные нанотрубки, графен;
- Органическая электроника (OLED, OTFT, OPV);
- Дисплеи (TFT-LCD, LTPS, IGZO, гибкие пленочные);
- Фотовольтаика, фотоника, солнечные элементы, CIGS, CdTe;